## ANNALES

# UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN-POLONIA

#### VOL. XII, 12

#### SECTIO AA

1957

Z Katedry Fizyki Doświadczalnej Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UMCS Kierownik: doc. dr Włodzimierz Żuk i z Katedry Fizyki Ogólnej Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UMCS Kierownik: doc. dr Armin Teske

# Barbara KLAMUT, Jadwiga SKIERCZYŃSKA, Janusz SKIERCZYŃSKI

## Pomiar kontaktowej różnicy potencjałów metodą kondensatorową

# Измерение контактной разности потенциалов конденсаторным методом

# Measurements of Contact Potential Differences by the Condenser Method

Kontaktową różnicą potencjałów, inaczej różnicą potencjałów Volty  $(U_k)$  nazywana jest różnica potencjałów, która istnieje między dwoma punktami położonymi tuż na zewnątrz powierzchni badanych metali ewentualnie półprzewodników (metale te ew. półprzewodniki powinny znajdować się w stanie równowagi termicznej i elektrycznej). Teoria i doświadczenie wykazały, że wielkość ta równa jest różnicy prac wyjścia z badanych powierzchni  $U_k = \varphi_1 - \varphi_2$  (2).

Istnieje wiele metod pomiaru kontaktowej różnicy potencjałów (k.r.p.). Wszystkie je można uważać za warianty czterech zasadniczych metod: kondensatorowej, jonowej, termoelektrycznej i fotoelektrycznej ((2), str. 107). Jedną z najczęściej stosowanych metod jest metoda kondensatorowa. Metodę tę zapoczątkował Volta, w roku 1851 została ona ulepszona przez Kelvina i następnie w r. 1932 przez Z i s m a n a (11).

Zasada pomiaru k.r.p. tą metodą jest prosta. Z badanych metali ew. półprzewodników sporządza się okładki kondensatora. Jeżeli obie okładki są połączone przewodnikiem, ustala się między nimi k.r.p. Istnienie tej różnicy potencjałów związane jest z istnieniem na okładkach pewnego ładunku. Przy oddalaniu jednej okładki od drugiej pojemność kondensatora zmienia się i część ładunku przepływa przez obwód. Jeżeli okładki połączone są przez wysoki opór  $\mathbb{R}^x$ , przepływ ładunku wytwarza na tym oporze spadek napięcia  $U_{\mathbb{R}^x}$ , który można zmierzyć. Pomiary najwygodniej jest wykonywać zapoczątkowaną przez Kelvina metodą kompensacyjną: przyłożenie do płytek napięcia dokładnie kompensującego k.r.p. powoduje, iż zmiany pojemności kondensatora nie wytwarzają spadku napięcia na oporze R<sup>x</sup>. Przy periodycznej zmianie pojemności kondensatora, a tym samym i periodycznej zmianie napięcia na oporze R<sup>x</sup> można przy pomiarach stosować wzmacniacze prądu zmiennego, co czyni tę metodę bardziej wygodną w użyciu.

Pomiary k. r. p. znajdują szerokie zastosowanie szczególnie przy badaniach stanów powierzchniowych, adsorpcji, dyfuzji i kinetyki różnych chemicznych procesów, a także w technice przy produkcji przyrządów próżniowych.

W niniejszej publikacji autorzy opisują oryginalną aparaturę do pomiaru k.r.p. zaprojektowaną i wykonaną w Zakładzie Fizyki UMCS oraz podają pewne pomiary wykonane na tej aparaturze.

#### APARATURA POMIAROWA

Skonstruowany zestaw do pomiaru k. r. p. metodą kondensatorową można podzielić na dwie zasadnicze części:

- a) głowica pomiarowa połączona z układem próżniowym,
- b) elektryczny układ pomiarowy.
  - a) głowica pomiarowa i układ próżniowy

Autorom chodziło o skonstruowanie łatwo rozbieralnej aparatury, dostosowanej do pomiarów w próżni oraz w atmosferze różnych gazów, która ponadto pozwoliłaby badać kilka różnych próbek w identycznych warunkach.

Przy takich założeniach zaprojektowano i wykonano głowicę pomiarową (rys. 1a). Głowica wykonana jest ze szkła twardego i składa się w zasadzie z dwóch części połączonych szlifem. Szlif ten o długości 7 cm i szerokości około 4 cm otoczony jest płaszczem wodnym. Dolną, zasadniczą część aparatury, zawierającą elementy metalowe, można więc wygrzewać bez obawy wyciekania smaru (dodatkowe zabezpieczenie stanowi wgłębienie w szlifie). Ze względu na dość duże rozmiary szlifu dostęp do wnętrza aparatury jest stosunkowo łatwy. Części metalowe ograniczono do minimum i —o ile to było możliwe — zatopiono w szkło.

Okładki kondensatora stanowią: wibrująca złota elektroda  $P_1$  oraz jedna z czterech próbek  $P_2$  umieszczonych w postaci płytek na stoliczku na dnie aparatury. Stoliczek ten (rys. 1b) w kształcie krążka o średnicy około 35 mm z otworem w środku zrobiony jest ze szkła i dokładnie wyszlifowany. Do stoliczka przytwierdzone są dwa kawałki żelaza (ż) zatopione w szkle. Przy pomocy elektromagnesu w kształcie podkowy umieszczonego na zewnątrz można obracać stoliczek dookoła pionowej osi i podsuwać pod wibrującą elektrodę  $P_1$  coraz inną próbkę. Ten sposób wymiany próbek wydaje się lepszy i wygodniejszy od stosowanego w innych pracach (4,8). Próbki umieszczone na stoliczku połączone są



Rys. 1. a) głowica pomiarowa, b) stoliczek

spiralnym drucikiem z elektrodą  $E_2$  wtopioną w dolną część aparatury, elektroda  $E_2$  połączona jest z pomiarowym oporem i wejściem przedwzmacniacza (patrz elektryczny układ pomiarowy). Wibrująca elektroda  $P_1$  przymocowana jest poprzez perełkę szklaną i drut wolframowy do końca cienkiej rurki szklanej  $r_1$ . Na drugim końcu tej rurki zatopiony jest szczelnie rdzeń żelazny R. Rurka  $r_1$  wsunięta jest do wnętrza drugiej odpowiednio dopasowanej rurki szklanej  $r_2$ wtopionej niecentrycznie do korka szlifu i może w niej poruszać się z bardzo małym tarciem. Prowadzenie przez kapilarę K eliminuje drgania elektrody w płaszczyźnie poziomej.

Na rurkę  $r_2$  nasunięta jest z zewnątrz cewka W tak, że obejmuje rdzeń R. Zasilana jest ona poprzez stabilizator prądem zmiennym o częstości sieciowej. Położenie cewki, która jest zamocowana w odpowiednim uchwycie, można zmieniać w sposób ciągły przy pomocy mikromanipulatora. Cewka ta pobudza do drgań elektrodę i pozwala jednocześnie regulować jej odległość od próbki w granicach od zera do kilku centymetrów. Rozwiązanie takie — wydaje nam się — jest bardziej wygodne od stosowanego przez innych autorów (4, 6, 8).

Płytka wibrująca  $P_1$  połączona jest z elektrodą  $E_1$ , do której z kolei przykłada się napięcie kompensujące. Elektroda wibrująca jest zamocowana w ten sposób, że można ją stosunkowo łatwo wymieniać, co też jest dużą zaletą układu.



#### Rys. 2. Aparatura próżniowa

G — głowica pomiarowa, C — elektrody połączeniowe wzmacniacza, Z — zbiornik gazu, K — kapilara, A — adsorbent — węgiel aktywowany, M — manometr Mac-Leoda, W — wymrażarka, PD — pompa dyfuzyjna rięciowa, S — suszka z P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, PR — pompa rotacyjna. W celu oczyszczania próbek przez wygrzewanie i bombardowanie elektronami aparatura zaopatrzona jest w spiralę S z drutu wolframowego.

Opisana wyżej głowica pomiarowa jest osłonięta podwójnym metalowym ekranem O zaopatrzonym w okienko w celu obserwacji. Podobnie cewka zamknięta jest w specjalnym metalowym pudełku. Wszystkie przyrządy zewnętrzne są starannie ekranowane.

Rurka M łączy opisaną aparaturę z układem próżniowym (rys. 2). Próżnia wytwarzana jest za pomocą trójstopniowej pompy dyfuzyjnej. W celu polepszenia próżni zastosowano adsorbent — aktywowany węgiel. Usuwanie par rtęci odbywa się za pomocą wymrażania mieszaniną zestalonego  $CO_2$  i alkoholu. W wymienionym układzie uzyskano próżnię poniżej  $10^{-5}$  mm Hg. Ciśnienie określano orientacyjnie manometrem Mac-Leoda. (Projektuje się zastąpienie manometru Mac-Leoda manometrem jonizacyjnym).

### b) elektryczny układ pomiarowy

Schemat blokowy układu przedstawiony jest na rys. 3. Za pomocą cewki W wprawia się w drganie jedną z okładek kondensatora  $C_d$ , co powoduje periodyczną zmianę jego pojemności.

Jeżeli na kondensatorze istnieje pewien ładunek Q, to — przy stałej różnicy potencjałów między okładkami — zmiana pojemności wywołuje zmianę wielkości tego ładunku (5). Wskutek tego na oporze  $\mathbb{R}^x$  pojawia się zmienne napięcie  $U_{\mathbb{R}}x = \mathbb{R}^x \frac{dQ}{dt}$  przekazywane następnie przez obwód  $\mathbb{R}_1$  C<sub>1</sub> na selektywny wzmacniacz prądu zmiennego.

Aby otrzymać możliwie dużą amplitudę napięcia  $U_Rx$  parametry obwodu  $R_1C_1$  oraz obwodu składającego się z dynamicznego kondensatora  $C_d$  i oporu  $R^x$  są dobrane tak, że:

$$\tau_1 < T; \tau_d < T$$

gdzie:  $\tau_1$  — stała czasowa obwodu wejściowego wzmacniacza równa  $R_1C_1$ ,  $\tau_d$  — stała czasowa obwodu kondensatora dynamicznego —  $R^x \cdot C_d$ ,

T — okres drgań elektrody ruchomej kondensatora dynamicz-

nego = 0.01 sek.

Aparatura elektronowa, służąca do wzmacniania impulsów występujących na oporze R<sup>x</sup>, musi posiadać dużą oporność wejściową, duży współczynnik wzmocnienia, mały poziom szumów własnych oraz musi być mało wrażliwa na zewnętrzne zakłócenia elektryczne i mechaniczne (9, 10).

Autorzy obliczyli i wykonali aparaturę elektronową odpowiadającą tym wymaganiom. Składa się ona z dwu zasadniczych elementów:

#### 134 Barbara Klamut, Jadwiga Skierczyńska, Janusz Skierczyński

- 1) przedwzmacniacza z wysokooporowym wejściem,
- 2) selektywnego wzmacniacza RC z wyjściem na oscylograf i prostownik.



Rys. 3. Schemat blokowy elektrycznego układu pomiarowego W — cewka poruszająca elektrodę dynamicznego kondensatora, P<sub>k</sub> — kalibrowany potencjometr obwodu kompensacji, B<sub>k</sub> — źródło napięcia kompensującego, C<sub>d</sub> dynamiczny kondensator, R<sup>x</sup> — wysokoomowy opór pomiarowy (2,5 · 10<sup>8</sup> $\Omega$ ), C<sub>1</sub> pojemność sprzęgająca (5 · 10<sup>-12</sup>F), R<sub>1</sub> — upływowy opór obwodu wejściowego wzmacniacza (2,5 · 10<sup>8</sup> $\Omega$ ).

I — przedwzmacniacz, II — wzmacniacz główny, III — oscylograf, IV — prostownik niskiego napięcia, V — filtr i stabilizator prądu żarzenia włókien lamp przedwzmacniacza, VI — filtr i stabilizator prądu żarzenia włókien lamp wzmacniacza, VII — wysokostabilizowany zasilacz obwodów anodowych.

Ad 1) Schemat przedwzmacniacza przedstawiony jest na rys. 4. Sygnał wejściowy przyłożony jest na siatkę lampy  $6 \times 10^8 \Omega$ . Oporność wejściowa lampy dla częstości sygnału 100 Hz jest rzędu  $2,5 \cdot 10^8 \Omega$ . Druga lampa  $6 \times 10^8 \Omega$  wyjściową wtórnika katodowego. Ze względu na małą oporność wyjściową wtórnika pozwala to na połączenie przedwzmacniacza ze wzmacniaczem za pomocą dość długiego kabla koncentrycznego.

Potencjały elektrod zostały dobrane tak, aby uzyskać jak najmniejszy poziom szumów spowodowanych przepływem prądów siatkowych oraz efektem śrutowym.

W celu uniknięcia zakłóceń, wywołanych napięciem o częstości przemysłowej, włókna lamp przedwzmacniacza zasilane są prądem stałym.



Rys. 4. Przedwzmacniacz

Prąd żarzenia otrzymuje się z zasilacza niskiego napięcia. Rys. 5. Napięcie żarzenia filtrowane jest na trójczłonowym filtrze L C. Dławiki filtru zbocznikowane są dodatkowymi kondensatorami o pojemnościach dobranych tak, że wraz z indukcyjnością dławika tworzą zaporowy obwód rezonansowy dla częstości 100 Hz. Pulsacja napięcia na wyjściu filtru jest rzędu  $10^{-6}$  %. Po wygładzeniu prąd żarzenia jest stabilizowany za pomocą baretera.

W celu wyeliminowania zewnętrznych zakłóceń elektrycznych przedwzmacniacz umieszczony został w cylindrycznym żelaznym ekranie. Użycie lamp o małym efekcie mikrofonowym oraz ich elastyczne zawieszenie



Rys. 5. Prostownik i stabilizatory prądu żarzenia

135

#### 136 Barbara Klamut, Jadwiga Skierczyńska, Janusz Skierczyński

zapobiega powstawaniu zakłóceń spowodowanych drganiami mechanicznymi.

Ad 2) Wzmacniacz główny zbudowany jest w układzie R C. Schemat jego przedstawiony jest na rys. 6.



Rys. 6. Wzmacniacz główny

W drugim stopniu umieszczony jest mostek R C typu podwójne T. Układ taki jest filtrem przepuszczającym tylko taką częstość f<sub>o</sub>, na jaką dostrojony jest mostek (w powyższym układzie f<sub>o</sub> = 100 Hz). Równoważna dobroć układu jest rzędu 15. Przy tej dobroci szerokość pasma przenoszonego przez układ przy częstości f<sub>o</sub> = 100 Hz wynosi 10 Hz. Wyjście wzmacniacza połączone jest przez pojemność 0,1  $\mu$ F z lampą oscyloskopową o czułości 0,5 mm/V.

Wszystkie stopnie są starannie zaekranowane; lampy umieszczone na elastycznych podstawkach. Włókna żarzenia zasilane są prądem stałym stabilizowanym.

Obwody anodowe przedwzmacniacza i wzmacniacza są zasilane z zasilacza o dużym współczynniku stabilności. Schemat zasilacza obwodów anodowych jest podany na rys. 7.

Stabilizator jest typu szeregowo równoległego. Lampą szeregową jest trioda głośnikowa typu AD — 1. Część równoległą stanowią lampy 6N9S i 6FS, które pracują w układzie dwustopniowego wzmacniacza prądu stałego. Układu taki zapewnia dużą stałość napięć.

Współczynnik niestabilności względem obciążenia jest rzędu  $N_{ob}=10^{-4}$ , a względem zmian napięcia prądu zmiennego  $N_{\sim}=10^{-3}$ .



Rys. 7. Zasilacz anodowy

W opisanym układzie czułość na wejściu przedwzmacniacza jest rzędu 30µV. Poziom szumów mierzony przy zwartych zaciskach wejściowych wynosi maximum 2µV. W poniższej tabelce są podane parametry poszczogólnych części układu.

#### Tabela 1.

Przed	lwzmac	niacz	Wzmacniacz			
Współczyn. wzmo <b>c-</b> nienia	Czułość µV	Poziom szumów µV	Współczyn. wzmoc- nienia	Czułość µV	Poziom szumów µV	
11	30	2	9.10 <sup>5</sup>	500	ole m . 70 Po wykou	

Pomiar k. r. p. przeprowadzano metodą kompensacji. W tym celu na drgającą elektrodę kondensatora  $C_d$  przykładano z dodatkowego obwodu potencjał liczbowo równy mierzonej k. r. p. Przy tak dobranym napięciu kompensującym wskaźnik na wyjściu wzmacniacza (oscylograf katodowy) wykazuje zero. (Obwód kompensujący (rys. 3) składał się z akumulatora ołowianego o napięciu 2,05 V oraz kalibrowanego potencjometru  $P_k$ klasy 0,5).

#### WYNIKI POMIARÓW

Podane niżej pomiary k. r. p. miały na celu jedynie sprawdzenie działania aparatury. Wykonywano je w powietrzu. Pomiar polegał na odczycie na dzielniku wartości napięcia całkowicie kompensującego k. r. p., tj. napięcia, po przyłożeniu którego amplituda obserwowanej na ekranie sinusoidy staje się równa zeru. Dokładność pomiaru określano najmniejszą zmianą wartości napięcia kompensującego, która powodowała pojawianie się sinusoidy o amplitudzie około 1 mm.

Ponieważ wzmacniacz pracował jako przyrząd zerowy, pomiar nie był zniekształcony ani "przesuwaniem się zera" ani wpływem "szumów".

Pomiary wykazały, że najlepsza dokładność, jaką można uzyskać na tej aparaturze przy powierzchni elektrod około 28 mm<sup>2</sup> — wynosi 2 mV. Uzyskiwanie takiej dokładności wymaga jednak równoległego ustawienia okładek kondensatora w odległości nie większej niż 0,1 mm, co jest bardzo kłopotliwe. Ze względu na trudności związane z równoległym ustawieniem okładek pomiary w większości przypadków wykonywane były z dokładnością 10 mV. Autorzy mają jednak nadzieję, że zmiana elementów wejściowych wzmacniacza pozwoli uzyskać większą dokładność pomiarów.

Elektrodę wibrującą stanowił elektrolitycznie pozłocony mosiężny krążek o średnicy 6 mm (powierzchnia około 28 mm<sup>2</sup>). Jako próbek badanych użyto Bi, Sb \*), monokrystalicznego Zn i pozłoconego mosiądzu.

Powierzchnie badanych metali były mechanicznie wypolerowane i następnie przemyte destylowaną wodą i alkoholem.

Średnie wartości k.r.p. w powietrzu otrzymane dla wyżej wymienionych metali przedstawia tabela 2.

the stoppidy	Talking May	Cabela 2.		3-10-19-20-24
Metal	Au	Bi	Sb	Zn
U <sub>k</sub> w woltach	- 0,08	+ 0,37	+ 0,15	+ 0,38

Pomiary wykonywane w ciągu kilku dni wykazały, że k.r.p. ulega ciągłym nieregularnym zmianom, wahając się wokół podanej wyżej wartości średniej. Różnica między maksymalną i minimalną wartością k.r.p. dla danego metalu nie przekraczała jednak 0,1 V. Wykres 1 ilustruje zmiany w czasie k.r.p. w przypadku próbki Sb. Wartość k.r.p. w każdym naniesionym na wykresie punkcie określona była z dokładnością

\*) Bi zawierał zanieczyszczenia: Mg — 10-40/0, Si — 10-50/0, Cu — 10-50/0, Ca — 10-50/0, Si = 10-50/0, As — 10-40/0.

do 2 mV. Z danych publikacji innych autorów (np. 1, 3, 7) należało oczekiwać, że wartość k. r. p. będzie ulegała podobnym nieregularnym wahaniom, odzwierciadlającym fluktuacyjny charakter zmian zachodzących na powierzchni badanej próbki \*).





Przemycie wibrującej płytki alkoholem i jej wysuszenie spowodowało zmianę średniej wartości k. r. p. (tab. 3).

Porównanie danych tabeli 2 z danymi tabeli 3 wyraźnie wykazuje, że praca wyjścia z płytki wibrującej na skutek przemycia jej alkoholem zmieniła się o około 0,14 V.

	T	a	b	e	1	a	3.
--	---	---	---	---	---	---	----

	Metal	Au	Bi	Zn
32,	U <sub>k</sub> w woltach	— 0,22	+ 0,22	+ 0,24

1) Brattain

Nasycenie powietrza parami alkoholu i eteru również wpływało na wartość k. r. p. (tab. 4). Wpływ ten zaznaczał się szczególnie silnie w przypadku płytki Zn. Ogrzanie zasadniczej części aparatury po wykonaniu pomiarów z alkoholem pozwoliło uzyskać wartości k. r. p. równe wartościom pierwotnym (tab. 4). Wyjątek stanowił Sb. Po wykonaniu pomiarów w atmosferze eteru nie udało się uzyskać wygrzewaniem pierwotnych wartości k. r. p.

Przedstawione wyżej pomiary zmian k. r. p. w czasie oraz zmian spowodowanych adsorpcją i desorpcją ilustrują typowe zastosowanie aparatury.

<sup>\*)</sup> Pomiary przedstawione na wykresie zostały wykonane w powietrzu po uprzednim napełnieniu aparatury parami eteru, toteż k.r.p. waha się wokół innej wartości aniżeli podana została w tab. 2.

Ponieważ opisana w niniejszej publikacji aparatura pozwala na wykonywanie pomiarów w próżni i w atmosferze dowolnych par i gazów, daje poza tym możność wykonywania pomiarów w identycznych warunkach dla kilku próbek, — autorzy mają nadzieję, że można ją będzie zastosować przy badaniu zagadnień tak z fizyki ciała stałego, jak i chemii fizycznej.

T	2	h	0	1	2	4
-	a	N	C	*	a	

Poniewa niekazteloo	Metal	Au	Bi	Sb	Zn
Pomiary 9) aparotik 7 yaki wanb	a) powietrze nasy- cone parą alko- holu etylowego	- 0,05	+ 0,29	+ 0,18	+ 0,67
U <sub>k</sub> w woltach	b)czyste powietrze	- 0,08	+ 0,37	+ 0,20	+ 0,39
	c) powietrze nasy- cone parą eteru	- 0,03	+ 0,42	+ 0,33	+ 0,99

Za życzliwe rady i pomoc przy wykonywaniu aparatury serdecznie dziękujemy Kierownikowi Warsztatu Mechaniki Precyzyjnej p. Tadeuszowi Lewandowskiemu.

### PIŚMIENNICTWO

- 1) Brattain W. H., Bardeen J.: Bell Syst. Techn. Journ., 32, 1 (1953).
- 2) Carew B. M.: Kontaktnaja raznost potencjałów (1955).
- 3) Farnsworth H. E., Winch R. P.: Phys. Rev. 58, 813, (1940).
- 4) Glasoe G. N.: Phys. Rev., 38, 1491 (1931).
- 5) Imiatiłow I. M.: Żurnał tiechn. fiz., 19, 1020 (1949).
- 6) Laszenko W. I., Stiepko I. I.: Izw. Ak. N., 16, 211, (1952).
- 7) Meyerhof W. E., Miller P. H.: Rev. Sc. Instr., 17, 15, (1946).
- 8) Mönch G.: Z. für Phys. 65, 233, (1930).
- Palevsky H., Swank R. K., Grenchik R.: Rev. Sc. Instr., 18, 298, (1947).
- 10) Reese H.: Nucleonics, 6, 41, (1950).
- 11) Zisman W.: Rev. Sci. Instr. 3, 367, (1932), (Carew B. M., Kontaktnaja raznost potencjałow (1955), str. 120).

## РЕЗЮМЕ

Авторы описывают установку для измерений контактной разности потенциалов конденсаторным методом.

Установка приспособлена к измерениям в вакууме и в атмосфере различных газов и дает возможность исследовать несколько образцов в одинаковых условиях. Установка содержит измерительный прибор с динамическим конденсатором, вакуумную установку и электрическую установку. В состав последней входит предусилитель с высокоомным входом и селективный усилитель RC с осциллографом на выходе.

Измерение к. р. п. производится по методу компенсации. Точность отсчета при поверхности электродов в 28 кв мм достигает 2 mV.

#### SUMMARY

The authors describe the apparatus constructed for the measurement of contact potential differences in gases as well as in vacuo. Several samples of metals or semiconductors may be placed side by side in a glass chamber and examined successively under identical conditions. The apparatus comprises a pumping system, a dynamical condenser, a preamplifier and an RC amplifier connected with an oscilloscope.

Potential differences down to 2 mV may be measured by the compensation method, the area of the electrodes being 28 mm<sup>2</sup>.

 Paper (ruk, set. II k). 80 g
 Format 70x10 // Druku 13 str.

 Annales U M.(.S. Lublin 1959.
 Lub. Druk. Prasowa-Lublin, Unicka 4.
 Zam. 3539 19 (X.59.

 600+125 egz. L-4
 Data otrzymania manuskryptu 19.1X.59 r.
 Data ukończenia orusu 21.160.

## J.M. QLS J.9

Авторы описьнают условеных для измереной контактной разности потенциалов конценсаторным кетолом, один — месето сайна сы для Удлановка приспозоблена к ванернових а нактума и в атмоссбере различных газов и дает возможность исследовать несколько оборацов в однамичных условиях. Установка содержит измерительный прибор с длиамическим конценсатором высучайую установку и заектрическую установку. В состав последней входят предусили он. с дисскомпьтическом и областивный усилитель БС с оснализиранос на выходе пьтическом и областивный усилитель БС с оснализиранос на выходе —Измерсило к ранских однования и основати предусили он. с дисскомным колокерском и областивный усилитель БС с оснализиранос на выходе измерсило к ранских производства по методу конценсация. Топность измерсило к ранскихости учестном за 28 кв мостистиета 2 го.

#### SUMMARY

The authors describe the apparatus constructed for the measurement of contact potential differences in gases as well as in vacuo, Several samples of metas, or semiconductors, may be placed adde by side in a glass chamber and examined successively under identical conditions. The apparatus comprises a pumping system, a dynamical conditions. a preamplifier and an RC amplifier characted with an definites on potential differences down to 2 MV may by measured to the restingence ration method, the area of the electrodes being 28 mm miskewomewal in

PISMIBANICTWD

I Bratizio W. S., Bardoan J. Bell Syn. Torin - Jorn, 20, 1 (1952).